样品电流模式下外磁场引起的 X 射线 吸收谱强度变化*

郭玉献 王 * 李红红 徐彭寿 王 锋 闫文盛

(中国科学技术大学国家同步辐射实验室,合肥 230029) (2005年12月12日收到,2006年1月17日收到修改稿)

在用样品电流模式的测量过程中发现,磁场强度、磁场与样品表面的夹角以及光斑在样品表面的位置都会对 吸收谱强度产生影响,在光斑、磁场和样品的不同几何配置下,测量并分析了表面均匀氧化的铝箔中氧的 K 边吸收 谱,指出外磁场下吸收谱强度随各种条件变化的趋势,并对实验结果给出了合理解释,结果表明所用的模型分析与 实验数据符合得很好,所得到的信息对于 XMCD 实验的设计安排、相应数据的分析以及物理信息的提取具有重要 意义.

关键词:X射线磁性圆二色,样品电流,外磁场,全电子产额 PACC:7870D

1.引 言

随着同步辐射装置的普及 利用样品对 X 射线 的吸收研究材料的结构特性、磁特性已成为一种'标 准 '的实验手段,如利用硬 X 射线吸收的扩展边精 细结构(extended X-ray absorption fine structure, EXAFS 研究晶态、非晶态中特定原子周围的配位信 息 以及通过 X 射线的近边吸收获得特定原子的结 构、价态等 这些对深入理解材料的具体结构提供了 有益的实验证据。利用铁磁性材料对左、右圆偏振 X 射线吸收的差异研究原子的磁矩性质是近年来基 于同步辐射装置的又一实验技术,作为 X 射线吸收 谱的一个分支, X射线磁性圆二色(X-ray magnetic circular dichroism, XMCD 技术对材料磁性研究提供 了强有力的工具 ;与传统的磁学研究工具相比 ,该技 术具有明显的优势:首先,和 X 射线吸收谱一样, XMCD 是一种具有元素分辨能力的实验技术;其次, 因为芯能级吸收谱主要是以偶极跃迁为主的量子力 学过程 理论分析较简单 通过适当近似能够确定原 子的轨道磁矩和自旋磁矩.

在 X 射线吸收的测量模式中,透射法比较直观

但对表面不敏感,在入射光子能量小于 2000 eV 的 软 X 射线波段,由于物质对该波段的光子有很强的 吸收,使得它们在样品中的穿透深度非常有限^[12], 因此在很大程度上限制了这种模式在软 X 波段的 应用,对于 3d 元素,荧光发射作为受激原子的一种 退激发方式,其产额大大低于相应的电子产额,也有 文献报道荧光产额与透射法测得的谱有差别,不能 反映原子的真实吸收^[3];目前,在反应动力学、催化 系统、以及表面的化学特性等方面的研究中,全电子 产额模式得到广泛应用.

从定义上讲,全电子产额指的是每个入射的光 子所产生的逸出样品电子数量,忽略饱和效应影响, 它与样品原子吸收截面成正比^[45].样品电流法实 际上就是间接测量全电子产额,在 XMCD 的吸收谱 测量过程中,由于外磁场的存在使逸出电子运动受 到影响,产生了信号畸变,这种情况甚至会直接影响 到元素的自旋磁矩与轨道磁矩的测量结果^[6].基于 这种情况,国际上通用的做法:一是利用铁磁性样品 的剩磁,由于不同样品甚至同一个样品在不同磁化 方向其剩磁很可能是不相同,而 XMCD 谱的测量要 求磁化达到饱和^{7]},所以这种方法会对测量的结果 产生一定影响^{8]};二是通过施加正反向不对称磁场

^{*} 国家大科学工程项目(批准号 P2B07, P2C07) 国家自然科学基金(批准号:10274073)资助的课题.

[†] E-mail : jiewang@ustc.edu.cn

消除光斑在样品上的不对称影响⁶¹,但是这种方法 没有考虑到入射光子能量变化对逸出电子的能量分 布和空间分布的影响,仍然会造成吸收谱的畸变;三 是用电子倍增器,通过加上正向电压吸引电子至饱 和,它与样品电流模式相比,具有与样品架的形状、 尺寸无关,以及与光斑在样品上的相对位置无关的 优点,但是,这种方法测到的信号与不加磁场时仍然 存在着差异.

本文分别在不同的磁场强度、不同的磁场与样 品表面夹角以及不同的光斑位置等配置下,测量均 匀氧化的铝箔中氧的吸收谱,用吸收峰的积分强度 来代表信号强度比较不同条件下信号强度的变化趋势,并通过分析对观测结果进行模拟和拟合,找出外 磁场下吸收谱强度的变化规律.

2. 实 验

样品电流法的原理如图 1 所示.把样品作为一 个极,光子投射到样品表面激发芯能级电子产生空 穴,原子退激发产生的一次电子在向样品表面移动 的过程中激发出大量的二次电子;样品保持电中性 的要求使它从接地的另一端补充等量的电子,在电 流计以上以样品电流的形式表示出来.



图1 样品电流测量原理图

2.1. 实验条件

样品是表面均匀氧化的铝箔,大小为 10 mm × 10 mm;采用合肥光源 U18 光束线引出的线偏振同 步光,这与 XMCD 使用的左、右圆偏振光不同,但由 于非铁磁样品无磁性圆二色效应,使用这两种偏振 光对吸收谱的测量结果没有影响;由于线偏光取自 电子储存环的轨道面上,因此能得到较大光子通量 有利于提高信噪比.

该光束线单色器采用变线距光栅,同时具有分 光与聚集的功能,可提供从100 eV 到1000 eV 的单 色化 X 射线;样品处光斑尺寸为 3 mm(H)×1 mm (V). 在分辨本领达到 1000 时,光子通量不低于 $10^8 s^{-[[9]}$;实验时的入缝和出缝分别为 0.3 mm 和 0.1 mm,扫描步长取 0.2 eV;为使得到的谱形有一定的 结构,能量扫描范围为氧的 K 吸收边(528 eV—550 eV);探测方式采取样品电流法间接测量全电子产 额,磁场是由直流电流驱动的电磁铁提供,其最大磁 场可达到 1600×10⁻⁴T,最小磁场增量在 1.8×10^{-4} T,样品、磁场和 X 射线的方向如图 2 配置.



图 2 样品、外磁场和入射光方向配置的顶视图

2.2. 信号随磁场与样品表面夹角的变化

在磁场强度 B 为 60×10^{-4} T 时,保持样品表面 S_0 与入射光方向 k 垂直, $B //S_0$,固定磁场方向,依 次绕垂直轴转动样品使磁场与样品表面的夹角 θ 分别为 0° , 10° , 20° , 30° , 40° ,测得其相应的吸收谱. 把 B 分别逐渐增大至 138×10^{-4} T 和 336×10^{-4} T,重 复上述操作.

为了更好比较不同磁场下信号强度 I 随夹角 θ 的变化 取吸收谱的积分强度作为信号强度 ;当样品 转动时 随着入射角增大 样品中电子的逃逸深度会 接近和超过 X 射线在样品中的穿透深度 ,这时会发 生饱和效应(又叫自吸收效应)^{10]};在共振吸收的峰 值处 ,这种影响更加明显 ,这种情况会造成探测信号 不能真实反应原子吸收截面 ,因此 ,本实验中必须考 虑由入射角变化而带来的饱和效应影响.

对于固定的入射角 θ,是否施加外磁场不会改 变饱和效应的影响程度,所以,在实验处理上,通过 加测不同 θ处零磁场的吸收谱,用它对相应角度的 加磁场吸收谱进行归一化;两者相除后的归一化信 号强度就去除了饱和效应影响;当入射角较大时,部 分光斑还可能会落在样品之外,引起入射光通量的 减少,通过上述归一化处理也能一并消除.

图3显示了不同磁场下,归一化的信号强度 *I*_{mana}随θ的变化关系,如图所示,它们存在一个共 同的变化趋势 随着夹角的增加 吸收谱的强度单调 地增加.



图 3 磁场强度分别为 60 × 10⁻⁴ T ,138 × 10⁻⁴ T ,336 × 10⁻⁴ T 时 , 归一化信号强度随磁场与样品表面夹角 θ 的变化

2.3. 信号随磁场强度的变化

在 θ 分别为 0° ,20° A0°时 ,测量信号强度 I 随 B 的变化. 类似地 ,为便于比较 ,用吸收峰的积分强度 来代表信号强度 ;为使不同 θ 的谱强度能进行比 较 ,用 2.2 中的方法归一化来消除饱和效应的影响. 得到信号强度 I_{normal} 随磁场 B 的变化关系(见图 4).

如图所示,对不同的 θ,随磁场的增大,信号强 度迅速衰减,但衰减的趋势也很快地减弱,信号强度



图 4 磁场与样品表面夹角 *θ* 分别为 0° ,20° ,40°时 ,归一化的信 号强度随外磁场的变化

最终趋近于一个常数 ;同时 ,比较不同角度下的衰减 曲线发现 ,它们的最终趋近值随 θ 的增大而增大 ; 这使通过增大 θ 值来提高磁场下的信号强度成为 可能.

总的看来,对上述三种不同的角度,I_{nomal}都随 B值的增加而迅速的衰减,θ角越大,随磁场 B衰 减的趋势越平缓,最终趋近值也越大.

2.4. 信号随光斑在样品位置的变化

为验证样品氧化的均匀性 ,进一步确定光斑在 样品不同位置时信号变化是由磁场引起 ,在入射角



图 5 光斑位于样品表面三个不同的位置(位置 1 *2 3* 分别对应样品上、中、下)所测得的 X 射线 吸收谱 (a)是不加磁场的情况 (b)加 42 × 10⁻⁴T 磁场

为 33°时,令 *B* // S₀,测量样品表面自上至下三个不同位置(依次是位置 1,2 和 3)的吸收谱信号,图 5 (a)是不加磁场的情况,图 5(b)加 42 × 10⁻⁴ T 的磁场.

从图 5 可以看出,不加磁场时三个谱基本没有 变化,加磁场时,随着光斑从样品上缘移到下缘,其 相应的谱的强度越来越强.

3. 分析与讨论

3.1. 作用原理

根据运动电子在磁场中的受力分析可知,电子 从样品表面逸出后,受到垂直于电子波矢 k 的洛仑 兹力的作用 将向着磁场的方向作螺旋形运动 洄旋 半径取决于电子的初速在垂直磁场方向的分量 v;; 如果电子在作螺旋运动过程中又回到样品表面 从 而对样品电流信号没有贡献 造成信号损失 我们认 为这就是磁场引起样品电流信号畸变的主要原因. 根据电子在样品表面的落点 把逸出电子分为3类: 1)在磁场中作螺旋线运动又回到样品表面 S。,这类 电子是样品电流信号中损失的部分.2)电子落回 到样品平面 S. 但位于 S. 之外,这部分电子是我们 测量到的信号的一部分 ;它们特点是易随着磁场的 增强 回旋半径变小 又回到 So 上 造成信号随磁场 的衰减.3)电子的运动轨迹与样品平面没有交点, 它构成信号的另一部分:由于这类电子受磁场的影 响不大,对角θ敏感,它构成了高磁场下的信号趋 近值

由作圆周运动的电子在磁场中的受力分析,易 导出电子的回转半径

$$R = \frac{m \cdot v_{\perp}}{e \cdot B} = \frac{\sqrt{2mE_{\perp}}}{e \cdot B}, \qquad (1)$$

其中 ,m ,e , v_{\perp} 分别表示电子质量、电子电荷和在电子速度在垂直磁场方向的分量 ,B 是磁场强度 , E_{\perp}

 $=\frac{1}{2}\cdot m\cdot v_{\perp}^{2}.$

可以看出,其他条件相同的情况下,逸出电子的 动能越大或者外磁场强度越小,其对应的回转半径 就越大.

3.2. 实验谱形的处理及分析

由图 3 可以看出,对于固定的磁场 B, θ 越大,

样品电流的信号就越强 ,呈单调递增趋势 ;并且外磁 场强度越大 ,这种增加的趋势越明显.对此 ,我们可 以这样解释 :当磁场的方向平行或接近于平行样品 表面时 ,最不利于电子的逸出 ,这时基本上只有第 2 类电子对信号有贡献 ,相反地 ,磁场越靠近表面的法 线方向 ,电子的逸出就越容易 ,这个增加量主要来自 于第 3 类电子 ;当 θ 增大时 ,第 3 类电子增加的同 时 ,第 1 类电子和第 2 类电子作小幅度的减少 ,它们 的总和保持不变 ;当磁场强度增大时 ,被磁场影响回 到样品表面的第 1 类电子增多 ,所以 ,一旦磁场与样 品表面的夹角增大 ,就会有更多的第 1 类电子转变 成第 3 类电子 ,从而造成高磁场下 ,信号强度随 θ 增 强的趋势更明显.

由于剔除了饱和效应的影响 图 3 仅仅反映信 号强度受磁场的影响,样品电流法测量的全电子产 额主要来自光激发的一次电子(包括光电子和俄歇 电子) 向样品表面运动过程中,由非弹性碰撞损失的 能量再激发的大量二次电子,这些大量的低能二次 电子构成了信号的主要来源,从理论上讲,当 θ 变 大时 会影响到所有的电子在垂直磁场方向的速度 分量 v_{\perp} ,有的电子 v_{\perp} 会变小,有的则会变大;小的 垂直分量 v 导致小的回旋半径 使电子更容易逸 出 定性地讲,电子速度v的方向愈靠近B,其对应 的 v_{\perp} 就愈小 ,电子就更容易逸出.若用 a 来表示 $B // S_0$ 时的归一化信号强度;对应无磁场作用时的 归一化强度为 1. 当 $\theta = 90^{\circ}$ 磁场中电子在运动过程 中将不会再回到样品表面,而是向着与样品表面垂 直的方向作螺旋形的运动,这时的强度也应该为1, 在 θ 从 0° 到 90° 的变化过程中,信号强度会慢慢增 大 增加的信号主要来源于速度方向与 B 邻近的电 子,为了表达这样一个随 θ 的变化趋势,我们近似 假定信号强度的增加是由样品转过的二面角 θ 内 逸出的电子引起的 ,而二次电子的空间角分布基本 遵守余弦定理11〕即逸出电子的角分布密度与电子 初速相对表面法线夹角的余弦成正比.

由于当 θ = 0°时,信号为a,当 θ = 90°时,信号为 1,则在 θ 从0°到90°的变化过程中,信号的总的增量 为(1 – a);令表面法线方向的电子分布密度为1,当 磁场与样品表面的夹角为 θ 时,在磁场方向信号的 角分布密度为 $\sin\theta$;增加的信号为对0和 θ 之间的 电子进行积分 $\int_{1}^{\theta} \sin x dx$;当 θ = 90°时信号达到最大

值 其增加量为电子数在 0 到 π/2 之间的积分

$$\int_{0}^{\pi/2} \sin x \, \mathrm{d}x = 1 ;$$

所以,信号的增量为

$$(1 - a) \cdot \int_{0}^{\theta} \sin x dx / \int_{0}^{\pi/2} \sin x dx = (1 - a) \cdot \int_{0}^{\theta} \sin x dx$$
,
这时的信号强度 / 为

$$a + (1 - a) \cdot \int_{0}^{a} \sin x \, \mathrm{d}x$$
,

化简后即是我们给出的经验公式

$$I = 1 - (1 - a) \cdot \cos\theta. \tag{2}$$

用这个公式对实验结果进行模拟,并与图 3 中 的实验曲线进行比较(见图 6),其中,图中的曲线是 根据公式模拟的结果,数据点是实验结果;可以看 出,实验与模拟结果相当符合;在大 θ 处符合结果 稍差,估计这是由于模拟中所作的近似处理造成的, 由于有 $\theta = 90^{\circ}$ 时的条件限制,这种偏差不影响 I_{normal} 随 θ 角的变化趋势;模型的选取基本上反映了在外 磁场中,归一化的信号强度 I_{normal} 随 θ 的变化规律.



图 6 在 30×10^{-4} T $,138 \times 10^{-4}$ T 和 336×10^{-4} T 的磁场下,归一 化信号强度随夹角 θ 变化的模拟结果(点状符号表示实验 数据)

当 θ 不变而增加 B 值时,会导致电子回旋半径 变小,逸出电子则更容易回到样品表面造成样品电 流信号损失,从而导致吸收谱强度随外磁场的增大 而减小,这个过程中,主要是第2类电子转变为第1 类电子,造成信号损失;磁场对第3类电子的影响不 明显,这从图4可以看出,随着磁场强度的增加,信 号强度逐渐趋近常数. 值得一提的是,当磁场与样 品表面平行时,其最终的趋近值并不为零,若认为它 是少数逸出的高能电子产生的信号,取 2A 驱动电 流产生的磁场强度 360×10⁻⁴T,高能电子的能量取 入射光子的能量最大值 560 eV,根据(1)式容易算 出,其相应的回转半径只有约 2.2 mm,光斑基本上 位于样品的中心,具有如此小回旋半径的电子不可 能从样品表面逸出,我们倾向于这个信号是由磁场 与样品表面不严格平行造成的,另外表面的粗糙度 也会产生影响.

若要模拟图 4 中的信号强度变化趋势比较困 难,因为信号来源于不同能量的电子,它们在磁场作 用下的畸变程度不同,同时这些电子的能量分布函 数又是未知的;由于随着电子逸出能量的增加,其相 应的回转半径也就越大,在磁场的作用下逃离样品 表面也越容易,换句话说其信号的畸变也就越小,取 逸出能量范围为 $E_i - E_i + \Delta E$ 的电子,其在磁场中 的性质用能量为 E_i 的电子近似代替 相应的电子数 量用权重因子 A_i 表示, $\sum_i A_i = 1$;则根据(1)式,它 们的回旋半径, $R_i \sim \sqrt{E_{\perp i}}/B$,注意到相同的磁场下 随样品面积增加,第 2 类电子越来越多地向第 1 类 电子转变,信号畸变程度增大,故在分母中引入面积 修正参数 P_{i2} ,根据前述的作用原理,第 3 类电子由 于受磁场作用不明显,构成了大磁场下的趋近值,用 P_{i3} 表示,考虑到上述影响,有

$$I_i \sim \left(\frac{\sqrt{E_{\perp i}}}{B + P_{i2}} + P_{i3}\right) \cdot A_i , \qquad (3)$$

其中, I_i 是能量为 $E_i - E_i + \Delta E$ 电子产生的信号 强度; A_i 表示这部分电子数量的权重因子; P_{i2} 是面 积影响因子; P_{i3} 是夹角 θ 的影响因子; $E_{\perp i}$ 是这个 能量范围的 v_{\perp} 对应的动能;最终的信号强度I =

 $\sum_{i} I_{i} \sim \sum_{i} \left(\frac{\sqrt{E_{\perp i}}}{B + P_{i2}} + P_{i3} \right) \cdot A_{i}$;由于不同能量的 电子在磁场下的衰减原理相同,为了拟合这个公式, 我们提出:用磁场下某一单能逸出电子的信号来代 替实验中各种不同能量电子的综合作用,即认为这 一能量的电子在磁场中的强度衰减与实验中各种不 同能量电子的衰减综合效果是一样的,这一能量定 义为等效逸出能 E_{eff} ,故提出如下拟合公式

$$I = \frac{P_1}{B + P_2} + P_3 , \qquad (4)$$

其中,I是最终获得的信号强度,B是磁场强度,

 $\frac{P_1}{B+P_2}$ 是对磁场敏感的第 2 类电子对信号的贡献, P_3 是对磁场不敏感的第 3 类电子的贡献;具体地 说, P_1 主要与 $\sqrt{E_{eff}}$ 有关,反映了逸出电子的平均 能量高低和分布状态,同时它也和第 1 2 类电子总 量有关 随着 θ 角增大,第 3 类电子增加, P_1 呈减小 的趋势; P_2 表示不同逸出能量的电子受样品面积影 响的综合值,样品面积越大, P_2 的值越大; P_3 表示 夹角 θ 角对不同能量电子趋近值的平均影响, θ 角 越大, P_3 的值越大,它的物理意义是高磁场强度下 的信号趋近值.

拟合结果如图 7 示 ,其中 数据点和曲线分别是 实验和拟合的结果 ;总的看来 ,这种趋势基本上是与 磁场强度 B 成反比例衰减的.



图 7 *θ* 为 0° 20° 40°的情况下,归一化信号强度随磁场强度的 变化拟合曲线(■表示实验数据)

这三个不同的角度下的拟合参数见表 1.

表 1 heta 为 0° ,20° A0°时 ,归一化的信号强度随磁场变化的

拟合参数比较

	0°	20°	40°
P_1	0.07143	0.06748	0.04484
P_2	0.07165	0.07663	0.05858
P_3	0.00324	0.11950	0.23464

从表中可以看出: *P*₃随着夹角 θ 的增大而增 大 ,表示有更多第 3 类电子逸出 ,对三个不同的 θ 值 *P*₂略有变化 ,我们认为这是由于三次测量是在不同 的束流注入下进行的 ,光斑在样品上的相对位置发 生变化 ,这个变化会导致光斑上(或下)的样品面积 发生变化 ,从而造成 *P*₂ 发生变化(具体原因后面将 有详细论述);由于电子储存环中轨道面虽有随机 性,但其偏离范围也有严格的控制,这决定了 P₂ 的 变化幅度不可能很大并且是随机的,同时,也说明信 号强度对光斑在样品表面的相对位置是很敏感的. 由于 θ 改变前后逸出的总电子数不变,所以 θ 增 大,第3类电子增多,会导致第1,2类电子的减少, 从而造成参数 P₁ 随 θ 的增大而减小.



图 8 样品、光斑以及电子回到样品表面的区域范围示意图

从图 5(a)可以看出,在无磁场的情况下,吸收 谱积分强度随光斑位置的变化很小,不超过 3% 这 说明铝箔氧化状况基本均匀;相比之下,图 5(b)中 谱信号随位置的变化就明显得多 其相应的积分强 度最大值几乎是最小值的2倍;这只能归结为磁场 中吸收谱对光斑位置的依赖。当光斑相对样品的位 置变动时 从上述的原理可以知道 :不管电子逸出方 向如何 根据磁场中带电粒子的受力分析 其作螺旋 运动的旋转方向是一致的 这些电子回到样品表面 时会落在光斑的同一侧(见图 8);光斑位置的相对 移动会使样品表面光斑以上的部分增大(或减少), 第1类电子的数量增大(或减小),从而导致随着光 斑朝一个方向运动时信号强度也作相应的单调变 化.这种单调变化的趋势从图 f(b)中可以明显地看 出来. 表现在 XMCD 实验中, 当采用固定入射光的 偏振方向 切换外磁场的方式时 逸出的二次电子会 分别落回样品表面光斑上面或者下面 ;如果光斑不 在样品的中心位置,会因这两部分不对称而使吸收 谱信号畸变程度不同 从而造成类似图 5(b)的正反 磁场下吸收谱分离的现象.

4. 实验总结

4.1.结论

通过实验得到了外磁场作用下吸收谱强度的变 化规律,并建立模型对这种变化作了相应解释. 首 先,信号强度经过归一化处理后,随磁场与样品的夹 角 θ 增大而变强,其变化趋势与根据模型提出的经 验公式1-(1-a)·cos θ 符合得很好;其次,吸收谱 强度随着外磁场的增加而剧烈的衰减,随磁场强度 的继续增加,其衰减趋势渐趋平缓,趋近值随 θ 增 大而增加,衰减的趋势用磁场强度 B 的反比例函数 $\frac{P_1}{B+P_2} + P_3$ 来拟合,效果很好,对拟合参数进行比 较分析,其变化的趋势与所表达的物理意义基本一 致;另外,在磁场作用下,光斑在样品上的相对位置 变化也会对吸收谱强度造成影响,并且这种影响随 着光斑向上(或向下)相对样品运动时,其信号强度 变化也是单调的,本文通过回流到样品表面电子数 的变化很好地说明了其单调变化的机理.

实验基本与提出的模型相符合,这一方面解释 了磁场下信号强度畸变的机理,另一方面也显示了 该模型在处理这个问题上的适用性.

4.2. 其他考虑与展望

实验研究对象是铝箔中氧的吸收谱,分析的结 果对 XMCD 中测量的吸收谱也同样适用 理论上讲, 铁磁性样品磁化所引入的磁场也需要考虑,但对纳 米薄膜来说,这种影响可以忽略不计.另外,用样品 电流法测量 XMCD 时,除了饱和效应外,磁场引起的 信号畸变也是造成样品磁矩测量误差的一个重要原 因,必要时应该考虑由磁场引起的误差剔除.

通过适当增大磁场与样品表面的夹角来增大样 品电流信号,可以减小信号畸变的程度,希望能以此 来突破实验站局限于剩磁测量 XMCD 谱^[12,13]的限 制,从而可以在外磁场存在的情况下,对垂直样品表 面的磁性和磁矩进行研究;另外,还希望能进一步研 究样品电流信号畸变程度对入射波长的依赖关系.

- [1] Chen C T, Idzerda Y U, Lin H J et al 1995 Phys. Rev. Lett. 75 152
- [2] Eimueller T, Fischer Schuetz P G, Guttmann P et al 1999 J. Alloys Compd. 286 20
- [3] Pompa M, Flank A M, Lagarde P et al 1997 Phys. Rev. B 56 2267
- [4] Stöhr J 1988 in X-ray Absorption: Principles, Applications, Techniques of EXAFS, SEXAFS and XANES, edited by Koningsberger D C and Prins R (Wiley, New York) p443
- [5] Lassailly Y, Drouhin H J, Van der Shuijs A J et al 1994 Phys. Rev. B 50 13054
- [6] Goering E, Gold S, Bayer A et al 2001 J. Synchrotron Rad. 8 434

- [7] Stöhr J, Nakajima R 1998 IBM J. Res. Dev. 42 73
- [8] Elmers H J, Wurmehl S, Fecher G et al 2004 Appl. Phys. A 79 557
- [9] Wang J, Li H H, Wang F et al 2005 Nuclear Techniques 28 489(in Chinese)[王、李红红、王锋等 2005 核技术 28 489]
- [10] Nakajima R , Stöhr J , Idzerda Y U 1999 Phys. Rev. B 59 6421
- [11] Iyasu T , Tamura K , Shimizu R et al 2004 Surf. Interface Anal. 36 1413
- [12] Li R P, Wang J, Li H H et al 2005 Acta Phys. Sin. 54 3851 (in Chinese) [李锐鹏、王、、李红红等 2005 物理学报 54 3851
- [13] Wang J, Li H H, Li R P et al 2005 Acta Phys. Sin. 54 5474 (in Chinese)[王、、李红红、李锐鹏等 2005 物理学报 54 5474

The variation of X-ray absorption spectra intensity caused by external magnetic field in drain current mode *

Guo Yu-Xian Wang Jie[†] Li Hong-Hong Xu Peng-Shou Wang Feng Yan Wen-Sheng

(National Synchrotron Radiation Laboratory, University of Science and Technology of China, Hefei 230029, China)

(Received 12 December 2005; revised manuscript received 17 January 2006)

Abstract

In the measurement of X-ray magnetic circular dichroism (XMCD) spectra, external magnetic field is required during experiment. We have found that, if the X-ray absorption spectra are recorded using drain current, the spectrum intensity is strongly influenced by external magnetic field. The normalized signal intensity changes with the value of the deviation angle between magnetic field and sample surface, the amount of the external magnetic field and the relative position of beam spot on sample surface. In this paper, the K edge absorption spectra of oxygen contained in aluminum foil are measured in different magnetic field configurations. The variation trends of signal intensity with the change in various external parameters are indicated, and reasonable explanations have been given. The experimental data are well accordance with their corresponding fitting curves, suggesting that the model constructed in this paper is applicable for solving this problem. The article provides a basis for analyzing the effects of external field on drain current signal.

Keywords : X-ray magnetic circular dichroism , external magnetic field , drain current , total electron yield PACC : 7870D

^{*} Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 10274073) and the National Key (Major) Scientific Engineering Foundation of China (Grant Nos. P2B07, P2C07).

[†] E-mail ;jiewang@ustc.edu.cn